パルスレーザーアブレーション法でのプルーム衝突によるデブリの低減
Reduction of the debris by the plume collision by the pulse laser ablation method.
甲南大理工¹, 奈良高専², ○香下将希¹, 横山泰寛¹, 福岡寛², 杉村陽¹, 梅津郁朗¹
Dept.of Phys.Konan Univ.¹, Nara National College of Technology²

 $^{\circ}$ Masaki Kashita 1 , Yasuhiro Yokoyama 1 , Hiroshi Fukuoka 2 , Akira Sugimura 1 , Ikurou Umezu 1

E-mail: m1321002@center.konan-u.ac.jp

我々は2つのターゲットを対向に設置し、プルームを衝突させることで複合ナノ結晶を形成させるダブルレーザーアブレーション(D-PLA)法を試みている。パルスレーザーアブレーション(PLA)法の問題点のひとつとしてデブリの混入があげられる。PLA 法でのデブリの除去方法として ECLIPSE 法がある。これはターゲットと堆積基板の間に遮蔽板を設置し、デブリの弾道性とナノ粒子の流体性を利用して堆積基板の遮蔽板による影部分にナノ結晶のみを堆積させる方法である。本研究ではこれを D-PLA に応用した。D-PLA ではプルーム衝突によるナノ結晶の流れの変化がデブリの堆積に影響すると考えられる。

図1のように D-PLA において遮蔽板を設置した。 D-PLA の場合プルーム衝突によってより多くのナノ結晶が遮蔽板の影の位置に入り込むと予想される。この効果を観察するために D-PLA と Si と Ge のそれぞれのシングルレーザーアブレーション(S-PLA)で試料を作製し、SEM で表面と断面を観察して比較した。

断面の SEM 画像から求めた膜厚を図 2 に示す。また、表面の SEM 画像から求めたデブリの面積比を Debris Areal Ratio とし図 3 に示す。 S-PLA ではナノ結晶もデブリも観察でき、これは雰囲気ガスの影響を受け、直進せずに堆積したと考えられる。 Si を例にとると膜厚は 2.5mm から-1.25mm にかけて厚くなっている。デブ

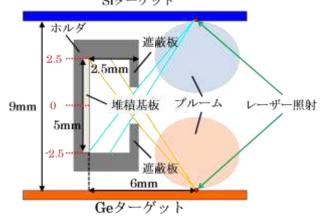
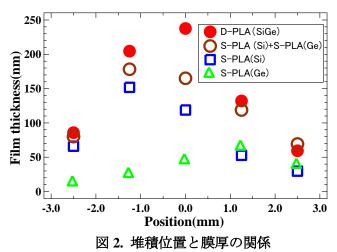


図1.D-PLA装置と遮蔽板

リは 2.5mm から緩やかに増加し-2.5mm では急激に増加している。D-PLA では膜厚は 0mm(基板中央)で最も厚くなり、0mm から離れていくほど薄くなっている。一方デブリは両端(2.5mm と-2.5mm)で最も多くなり、それ以外では同程度で両端と比べるとかなり少なくなった。基板中央に注目すると膜厚とデブリに関して Si と Ge の S-PLA をそれぞれ足し合わせた値と D-PLA の値を比較すると膜厚は D-PLA は S-PLA を足し合わせた値の約 1.4 倍でデブリは同程度であった。これはプルームの衝突によって形成される基板に対して、垂直方向へのガスの流れがデブリよりもナノ結晶に大きな影響を与えることを示す。



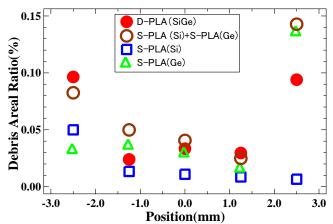


図3. 堆積位置と表面でのデブリ面積比